

Лабораторная работа №3:

«Обработка экспериментальных данных по определению времени проявления фоторезиста в технологии фотолитографии на основе регрессионного анализа»

по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация вариант: <u>9</u>

Выполнил: Неграш Андрей, Р34301

Преподаватель: Рассадина Анна Александровна

1. Цель

Определить коэффициенты регрессии полинома первого порядка, описывающего модель проявления фоторезиста в технологии фотолитографии; определить корреляционные связи между входными и выходными факторами.

2. Обработка результатов измерений

Результаты экспериментального определения времени проявления фоторезиста согласно матрице планирования эксперимента приведены в таблице:

№ опыта	Время проявления фоторезиста Тп, с			
1	25			
2	193			
3	64			
4	12			

2.1. Составление матрицы планирования эксперимента

Для построения модели проявления воспользуемся методом планирования дробного факторного эксперимента. В проводимом эксперименте принимает участие 3 фактора, тогда число необходимых опытов $N = 2^{3-1} = 4$.

Матрица планирования эксперимента выглядит следующим образом:

№ опыта	h (x ₁)	$t_{3}(x_{2})$	f (x ₃)	$T_{\pi}(y_n)$
1	-1	-1	+1	25
2	+1	-1	-1	193
3	-1	+1	-1	64
4	+1	+1	+1	12

Таким образом экспериментальные данные для каждого из четырёх опытов приведены в таблице:

№ опыта	Н, мкм	Тэ, с	F, %	T _n , c
1	0,35	85	0,8	25
2	0,55	85	0,4	193
3	0,35	205	0,4	64
4	0,55	205	0,8	12

2.2. Определение коэффициентов регрессии

Определение коэффициентов регрессии происходит по формулам:

$$a_0 = \frac{\sum_{n=1}^{N} y_n}{N}, \quad a_i = \frac{\sum_{n=1}^{N} x_{in} * y_n}{N}$$

Вычислим коэффициенты регрессии для наших измерений:

$$a_0 = \frac{25 + 193 + 64 + 12}{4} = \frac{294}{4} = 73,5 \text{ c}$$

$$a_1 = \frac{-1 * 25 + 1 * 193 + (-1) * 64 + 1 * 12}{4} = \frac{116}{4} = 29 \text{ c}$$

$$a_2 = \frac{-1 * 25 + (-1) * 193 + 1 * 64 + 1 * 12}{4} = \frac{-142}{4} = -35,5 \text{ c}$$

$$a_3 = \frac{1 * 25 + (-1) * 193 + (-1) * 64 + 1 * 12}{4} = \frac{-220}{4} = -55 \text{ c}$$

2.3. Запись уравнения модели проявления фоторезиста Модель проявления фоторезиста может быть записана в виде:

$$T_{\Pi} = a_0 + a_1 h + a_2 t_3 + a_3 f$$

Согласно полученным ранее коэффициентам регрессии запишем уравнение модели проявления фоторезиста:

$$T_{\Pi} = 73.5 + 29h - 35.5t_{9} - 55f$$

2.4. Определение средних значений и среднеквадратических отклонений для заданных факторов

Формула для вычисления среднего значения выглядит следующим образом:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

Тогда средние значения для каждого из факторов и для полученных значений времени проявления фоторезиста будут соответственно равны:

$$\bar{h} = \frac{0,35 + 0,55 + 0,35 + 0,55}{4} = \frac{1,8}{4} = 0,45 \text{ MKM}$$

$$\bar{t}_{3} = \frac{85 + 85 + 205 + 205}{4} = \frac{580}{4} = 145 \text{ c}$$

$$\bar{f} = \frac{0,8 + 0,4 + 0,4 + 0,8}{4} = \frac{2,4}{4} = 0,6\%$$

$$\bar{T}_{\Pi} = \frac{25 + 193 + 64 + 12}{4} = \frac{294}{4} = 73,5 \text{ c}$$

Формула для вычисления среднеквадратического отклонения выглядит следующим образом:

$$S_X = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (X_i - \bar{X})^2}$$

Тогда значения среднеквадратического отклонения для каждого из факторов и для полученных значений времени проявления фоторезиста будут соответственно равны:

$$S_h = \sqrt{\frac{2*(0,35-0,45)^2+2*(0,55-0,45)^2}{3}} = \sqrt{\frac{0,04}{3}} = 0,12 \text{ мкм}$$

$$S_{t_3} = \sqrt{\frac{2*(85-145)^2+2*(205-145)^2}{3}} = \sqrt{\frac{14400}{3}} = 69,28 \text{ c}$$

$$S_f = \sqrt{\frac{2*(0,8-0,6)^2+2*(0,4-0,6)^2}{3}} = \sqrt{\frac{0,16}{3}} = 0,23\%$$

$$S_{T_n} = \sqrt{\frac{(25-73,5)^2+(193-73,5)^2+(64-73,5)^2+(12-73,5)^2}{3}} = \frac{\sqrt{2352,25+14280,25+90,25+3782,25}}{3} = \sqrt{\frac{20505}{3}} = 82,67 \text{ c}$$

2.5. Определение коэффициента корреляции Вычисление коэффициенты корреляции происходит по формуле:

$$R_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{NS_X S_Y}$$

Вычислим коэффициенты корреляции между временем проявления фоторезиста и каждым из факторов.

Коэффициент корреляции между временем проявления и толщиной фоторезистора:

$$R_{T_{\Pi}h} = \frac{11.6}{4 * 82.67 * 0.12} = \frac{11.6}{39.68} = 0.30$$

Коэффициент корреляции между временем проявления и временем экспонирования:

$$R_{T_{\Pi}t_{9}} = \frac{-8520}{4 * 82,67 * 69,28} = \frac{-8520}{22909,51} = -0,37$$

Коэффициент корреляции между временем проявления и концентрацией щёлочи в проявителе:

$$R_{T_{\Pi}f} = \frac{-44}{4 * 82.67 * 0.23} = \frac{-44}{76.06} = -0.58$$

3. Выводы по работе

В процессе выполнения данной лабораторной работы были получены следующие выводы:

- 3.1. Данный эксперимент можно отнести к активным факторным экспериментам, поскольку его целью было установление зависимости между значением времени проявления фоторезиста и независимых изменяющихся факторов.
- 3.2. Если сравнить коэффициенты регрессии и коэффициенты корреляции между временем проявления и соответствующему каждому коэффициенту регрессии фактору, то мы увидим, что они имеют одинаковые знаки, а также одинаковые отношения друг к другу:

$$\frac{R_{T_{\Pi}h}}{a_1} = \frac{0.30}{29} = 0.011; \quad \frac{R_{T_{\Pi}t_3}}{a_2} = \frac{-0.37}{-35.5} = 0.011; \quad \frac{R_{T_{\Pi}f}}{a_3} = \frac{-0.58}{-55} = 0.011$$

Данное совпадение подтверждает правильность вычислений, ведь и коэффициент регрессии, и коэффициент корреляции показывает уровень влияния данного фактора на итоговое значение времени проявления фоторезиста.

- 3.3. Исходя из вычисленных коэффициентов регрессии, взятых по модулю, видно, что $|a_3| > |a_2| > |a_1|$. Таким образом можно сказать, что наименьшее влияние оказывает толщина фоторезиста, а наибольшее концентрация щёлочи в проявителе.
- 3.4. По знаку вычисленных коэффициентов регрессии можно заметить, что увеличение толщины фоторезиста увеличит время его проявления, а увеличение времени экспонирования и концентрации щёлочи в проявителе уменьшит время проявления фоторезиста.